

化学工学会第 51 回秋季大会 材料・界面部会横断型シンポジウム(共催)  
ST-22 CVD・ドライプロセス –構造・機能制御の反応工学– 報告書

オーガナイザー

島田 学 (広島大学) (文責)

羽深 等 (横浜国立大学)

西田 哲 (岐阜大学)

杉目恒志 (早稲田大学)

2020 年 9 月 24～26 日にオンライン開催された化学工学会第 51 回秋季大会にて本シンポジウムが開催され、合計 24 件の講演発表が行われた。詳細は下記の通りである。

日時	9 月 25 日 9:20～15:20 13 件(展望講演 1 件、招待講演 1 件を含む) 9 月 26 日 9:00～14:20 11 件(展望講演 1 件、招待講演 1 件を含む)
会場	オンライン
聴講者数	34 名
展望講演	『プラズマ成膜技術の将来展望』後藤哲也氏(東北大学)
招待講演	『原子層堆積法の諸課題とセミバッチ法の展開・展望』加藤寿氏・瀬下裕志氏(東京エレクトロンテクノロジーソリューションズ株式会社) 『高品質 GaN 基板を実現する HVPE 成長新技術;マスクレス 3D 法』吉田丈洋氏(株式会社サイオクス) 『プラズマ化学気相成長法によるケイ素および窒素を添加したダイヤモンドライクカーボン薄膜の特性評価』中澤日出樹氏(弘前大学)

以上